

International Preliminary
Examination Report

特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

(法第12条、法施行規則第56条)

[PCT36条及びPCT規則70]



出願人又は代理人 の登録記号 148458-182	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2004/009152	国際出願日 (日.月.年) 29. 06. 2004	優先日 (日.月.年) 03. 07. 2003
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. 7 H01L21/68, B65G49/00		
出願人(氏名又は名称) 東京エレクトロン株式会社		

1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。
法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。

3. この報告には次の附属物件も添付されている。
 a. 附属書類は全部で ページである。
 指定されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙 (PCT規則70.16及び実施細則第607号参照)
 第I欄4. 及び补充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとの国際予備審査機関が認定した差替え用紙

b. 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に連絡するデータを含む。(実施細則第802号参照)

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

第I欄 国際予備審査報告の基礎
 第II欄 優先権
 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
 第IV欄 発明の單一性の欠如
 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文獻及び説明
 第VI欄 ある種の引用文獻
 第VII欄 国際出願の不備
 第VIII欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 06.12.2004	国際予備審査報告を作成した日 19.07.2005
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 中島 昭浩 電話番号 03-3581-1101 内線 3324
	3U 9147

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT第35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1 - 5	有
	請求の範囲		無
進歩性 (I S)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1 - 5	無
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲	1 - 5	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

- 文献1 : J P 2 0 0 0 - 1 5 0 6 1 3 A (東京エレクトロン株式会社) 2 0 0 0 . 0 5 . 3 0
 文献2 : J P 5 - 2 7 5 5 1 2 A (株式会社東芝) 1 9 9 3 . 1 0 . 2 2
 文献3 : J P 8 - 2 9 3 5 3 4 A (東京エレクトロン株式会社) 1 9 9 6 . 1 1 . 0 5
 文献4 : J P 2 0 0 2 - 1 7 0 8 6 0 A (平田機工株式会社) 2 0 0 2 . 0 6 . 1 4
 文献5 : J P 6 - 3 0 2 6 7 9 A (東京エレクトロン株式会社) 1 9 9 4 . 1 0 . 2 8

請求の範囲1に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1と国際調査報告で引用された文献2と国際調査報告で引用された文献3により進歩性を有しない。

半導体処理装置において、駆動手段から発生する塵埃が被処理体を汚染することは從来周知の課題であり、前記塵埃の影響を低減する手段としてカバー等で覆い、該カバー内を排気することも從来周知の技術手段であることから（文献2、3参照）、これを文献1の蓋閉閉機構3 0 の駆動手段である蓋閉閉用のエアシリング3 6、屈伸リンク機構3 7に適用することに格別の困難性は認められない。

請求の範囲2に係る発明は、文献1と文献2と文献3と国際調査報告で引用された文献4により進歩性を有しない。

文献1の隔壁ユニット1 8 の昇降を行なうZ軸エアシリング2 1 及び隔壁ユニット1 8 の隔壁1 2への接離を行なうカム溝2 5、カム板2 6、カムローラ2 8、Xシリング2 7に換えて、文献4の五いに傾斜面を備えた部材を相対的に昇降させることにより傾斜面どうしの接離を行なう機構を用いることに格別の困難性は認められない。

請求の範囲3に係る発明は、文献1と文献2と文献3と文献4により進歩性を有しない。

文献1には、蓋ロック部材3 3 は連通口1 3 に閉塞可能な旨記載されていることから（段落0 0 3 0 参照）、蓋ロック部材3 3 と隔壁1 2との閉塞をより効果的に行なうために、シールを隔壁1 2に設けることは、当業者であれば困難なく想到し得る事項であると認められる。

請求の範囲4に係る発明は、文献1と文献2と文献3と文献4により進歩性を有しない。

シールとして、Y字型の断面形状を備えるものは從来周知である。

請求の範囲5に係る発明は、文献1と文献2と文献3と文献4と新たに引用した文献5により進歩性を有しない。文献5には、電磁バルブ1 4 8 を開き、2つの空間を開放して気圧差を無くす点が記載されている（段落0 0 7 2、図7参照）。

文献1の隔壁室1 7 と移動室6との圧力を同じにする手段として、バージポート3 8、排気ポート3 9を用いること換えて、文献5の電磁バルブ1 4 8 を用いることに格別の困難性は認められない。

また、半導体製造装置において、気流により塵埃が舞い上がるることを防ぐために、気流の流れを調整するようにバルブの開度を制御することは從来周知の事項であり、文献5の電磁バルブを徐々に開放することも当業者が必要に応じて適宜なし得る事項にすぎない。